



Customer No. 31561 Application No.: 10/707,825 Docket No. 10786-US-PA

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Applicant

: Liu et al.

Application No.

: 10/707,825

Filed For : Jan 15, 2004 : GQLD BUMP STRUCTURE AND FABRICATING

METHOD THEREOF

Examiner

: GRAYBILL, DAVID E

Art Unit

: 2822

ASSISTANT COMISSIONER FOR PATENTS

Alexandria, VA22314

Dear Sirs:

Transmitted herewith is a certified copy of Taiwan Application No.: 92106257, filed on: 2003/3/21.

A return prepaid postcard is also included herewith.

Respectfully Submitted,

JIANQ CHYUN Intellectual Property Office

Dated: May 9, Je

By:

Belinda Lee

Registration No.: 46,863

Please send future correspondence to:

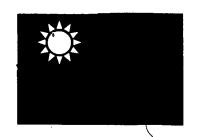
7F.-1, No. 100, Roosevelt Rd.,

Sec. 2, Taipei 100, Taiwan, R.O.C.

Tel: 886-2-2369 2800

Fax: 886-2-2369 7233 / 886-2-2369 7234

E-MAIL: BELINDA@JCIPGroup.com.tw; USA@JCIPGroup.com.tw



विष विष विष विष

中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,

其申請資料如下:)

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder

申 請 日: 西元 2003 年 03 月 21 日

Application Date

申 請 案 號: 092106257

Application No.

申 請 人:國立中央大學

Applicant(s)

局

長

Director General







CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

發文日期: 西元 2004 年 1 月 2

Issue Date,

發文字號: 09320071190

Serial No.



		-
申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

(以上各欄由本局填註) 發明專利說明書				
	中文	覆晶金凸塊結構及其製造方法		
發明名稱。	英 文	Flip chip Au bump structure and method of manufacturing the same		
	姓 名 (中文)	1. 劉正毓 2. 王信介		
÷	(英文)	1.Cheng-Yi Liu 2.Shen-Jie Wang		
發明人 (共2人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW 2. 中華民國 TW		
	住居所(中文)	1. 桃園縣中壢市九和一街18號13樓之3 2. 台北縣中和市立德街193號3樓		
,	年福州	1.13Fl3, No. 18, Jiouhe 1st St., Jungli City, Taoyuan, Taiwan 320, R.O.C. 2.3Fl., No. 193, Lide St., Junghe City, Taipei, Taiwan 235, R.O.C.		
		1. 國立中央大學		
	名稱或 姓 名 (英文)	1. National Central University		
三、	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW		
申請人 (共1人)		1. 桃園縣中壢市五權里中大路300號 (本地址與前向貴局申請者相同)		
	住居所(營業所)	1.No. 300, Jungda Rd., Jungli City, Taoyuan, Taiwan 320, R.O.C.		
	代表人(中文)	1. 劉全生		
	代表人(英文)	1. Chuan-Sheng Liu		

四、中文發明摘要 (發明名稱:覆昆金凸塊結構及其製造方法)

一種覆晶金凸塊結構及其製造方法,其結構係配置於晶片上之金凸塊表面鍍上鎮層及銅層,其中鎮層係鍍於金凸塊表面,銅層則覆蓋於鎮層表面,而形成鎮/銅阻障層。藉由金凸塊上鍍的鎮/銅層,阻障金凸塊與銲料之界面反應,而避免快速反應的金-錫間面反應,因而避免產生脆性的覆晶凸塊接點。

伍、(一)、本案代表圖為:第___2 圖

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:

200: 晶圓

202: 金凸塊

204: 鎳層

206: 銅層

陸、英文發明摘要 (發明名稱: Flip chip Au bump structure and method of manufacturing the same)

A flip chip Au bump structure and method of manufacturing the same are provided. The structure is that Au bumps coated with a nickel layer and a copper layer located on a chip, wherein the nickel layer is coated on a surface of the Au bumps and the copper layer is coated on a surface of the nickel layer to form a nickel/copper barrier layer. Because of the





四、中文發明摘要 (發明名稱:覆晶金凸塊結構及其製造方法)

陸、英文發明摘要 (發明名稱:Flip chip Au bump structure and method of manufacturing the same)

nickel/copper barrier layer on the surface of the Au bumps, the interfacial reaction between Au bumps and solder will be hindered, and it can retard fast interfacial reaction of Au-Sn interface, whereby avoiding forming cold joint.



一、本案已向	,		, .
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先權
二、□主張專利法第二十	五條之一第一項係	憂先權:	
申請案號:			
日期:			
三、主張本案係符合專利;	法第二十條第一工	頁□第一款但書	或□第二款但書規定之期間
日期:			
四、□有關微生物已寄存:	於國外:		
寄存國家:			
寄存機構: 寄存日期:			
奇仔日期: 寄存號碼:			
□有關微生物已寄存:	於國內(本局所指	定之寄存機構)	:
寄存機構:			
寄存日期:			
寄存號碼:			
□熟習該項技術者易	於獲得,不須寄存		
	•		
IIII KX:P\Q\IA(B\)PB\;\rangle			

五、發明說明(1)

發明所屬之技術領域

本發明是有關於一種凸塊(bump)結構及其製造方法,且特別是有關於一種覆晶金凸塊(gold bump)結構及其製造方法。

先前技術

隨著半導體業的進展,許多相關技術也日新月異地在不斷演進中。就半導體成品製造而言,一般可分為三個階段,一為半導體基底的形成、再則半導體元件製造、最最則是封裝製程(package),而現今的晶片級封裝技術方面有漸朝向覆晶封裝(flip chip)的封裝方式。由於覆晶對裝技術可降低晶片與基板間的電子訊號傳輸距離,所且對裝技術可降低晶片與基板間的電子訊號傳輸上,與大小選別,與大小差不多,因此目前封裝技術中的主流之一就屬覆品對裝技術最受矚目,其應用的範圍包括高階電腦、PCMCIA卡、軍事設備、個人通訊產品、鐘錶以及液晶顯示器等。

而在封裝技術中有所謂的「凸塊」,係指於晶圓上所長的金屬凸塊,每個凸塊皆是IC信號接點。金屬凸塊多用於體積較小的封裝產品上,其種類有金凸塊(high lead塊(eutectic solder bump)及高鉛錫鉛凸塊(high leadsolder bump)等。其中,以金凸塊最受到注意;因為高頻元件通常以金為主要金屬,但因為含錫的銲料與金凸塊會形成快速的金-錫(Au-Sn)界面反應,導致兩者界面接點處形成過多金-錫的介金屬化合物。如第1圖所示,其係習知





五、發明說明(2)

使用金凸塊於覆晶封裝時的元件剖面示意圖。

請參照第1圖,於一晶片1.00上形成有一金凸塊102, 而當金凸塊102與銲料104接觸後,會在界面接點處形成一 個非常脆性的金-錫化合物(cold joint)106。因此,金凸 塊使用在覆晶封裝中的C4(controlled collapse chip connection)凸塊會有可靠度的問題,所以要如何研發一 阻障層防止金凸塊與銲料快速反應,對於應用金凸塊於覆 晶封裝是一大挑戰。

發明內容

因此,本發明之目的是提供一種覆晶金凸塊結構及其製造方法,以避免金凸塊與銲料間之快速反應所造成的脆性金-錫介金屬化合物。

本發明之另一目的是提供一種覆晶金凸塊結構及其製造方法,以提供覆晶式封裝成本低與製程簡單的凸塊。

本發明之再一目的是提供一種覆晶金凸塊結構及其製造方法,以避免在發金凸塊與銲料界面產生脆性銲點。

根據上述與其它目的,本發明提出一種覆晶金凸塊結構係配置於一晶圓上,其結構包括數個金凸塊、鎳層以及銅層,其中鎳層係鍍於金凸塊表面,銅層則覆蓋於鎳層表面,以形成鎳/銅阻障層(barrier laver)。

本發明再提出一種覆晶金凸塊結構的製造方法,包括於一晶圓上先形成數個金凸塊,再於金凸塊表面鍍一錦層。之後,於鎳層表面鍍一銅層。

本發明另外提出一種覆晶式封裝的結構,係配置於一





五、發明說明(3)

晶片與一晶片基材之間,其結構包括數個金凸塊、鎮層以及含銅的銲料,其中鎮層係鍍於金凸塊表面。而含銅的銲料是位於晶片基材上,用以接合晶片與晶片基材。

本發明又提出一種覆晶式封裝方法,適於接合一晶片與一晶片基材。其步驟是先於晶圓上製作金凸塊,再於金凸塊表面鍍一鎮層。之後,晶圓切割進行,再提供一含銅的銲料於晶片基材上。隨後,對準金凸塊與含銅的銲料。之後,進行迴銲(reflow)。

本發明因為在金凸塊上鍍有鎳/銅層,而覆晶金凸塊結構與銲料之界面所形成的界面化合物是四元的(Au, Cu, Ni)Sn2化合物,而非習知金與錫間因迴銲所產生的AuSn4化合物。因此,本發明可解決覆晶金凸塊結構與錫銲料快速反應所造成的問題。

為讓本發明之上述和其他目的、特徵、和優點能更明顯易懂,下文特舉較佳實施例,並配合所附圖式,作詳細說明如下:

實施方式

第一實施例

第2圖係依照本發明之一第一實施例之覆晶金凸塊 (gold bump)的剖面示意圖;。

請參照第2圖,本發明之覆晶金凸塊結構係配置於一晶圓200上,其結構包括金凸塊202、鎮層204以及銅層206,其中金凸塊202之高度約在3~150微米之間。鎮層204係鍍於金凸塊202表面,且其厚度約在0.1~20微米之間。





五、發明說明(4)

而 銅 層 206 覆 蓋 於 鎳 層 204 表 面 , 其 厚 度 約 在 0.1~10 微 米 之 間 。

為說明本實施例之覆晶金凸塊結構的製造流程,請參考第3圖。

第3圖係製造第2圖所示之覆晶金凸塊結構的步驟圖。請參照第3圖,於步驟300中,於晶圓上形成金凸塊,其步驟例如是電鍍法(electroplating)或無電鍍法。然後,於步驟302中,於金凸塊表面鍍一鎳層,且其製作方法例如是電鍍法或無電鍍法。之後,於步驟304中,於鎳層表面鍍一銅層,且其製作方法例如是電鍍法或無電鍍法。

當本實施例之覆晶金凸塊結構應用於覆晶封裝技術時,由於鍍在金凸塊上的鎳/銅層具有阻障層之功效,所以可大幅降低金與錫間因迴銲所產生的介金屬化合物,如AuSn4,且覆晶金凸塊結構與銲料(solder paste)之界面所形成的界面化合物是以(Au,Cu,Ni)Sn2化合物為主,其生長速率較AuSn4緩慢。因此,本發明可解決覆晶金凸塊結構與錫銲料快速反應所造成的問題。

第二實施例

第4圖係依照本發明之一第二實施例之覆晶式封裝的結構剖面示意圖。

請參照第4圖,本發明之覆晶式封裝的結構係配置於一晶片400與一晶片基材410之間,其結構包括數個金凸塊402、鎮層404以及含銅的銲料406,其中金凸塊402之高度約在3~150微米之間、含銅的銲料406可以是一錫銅合金,





五、發明說明 (5)

且其中的銅含量約在0.7~3.0 wt%之間。鎮層404係鍍於金凸塊402表面,且其厚度約在0.1~20微米之間。而含銅的銲料406是位於晶片基材410上,用以接合晶片400與晶片基材410。

為說明本實施例應用於覆晶式封裝的製造流程,請參考第5圖。

第5圖係將第4圖之結構應用於覆晶式封裝的步驟圖。請參照第5圖,於步驟500中,於晶圓上數個金凸塊,其步驟例如是電鍍法或無電鍍法。然後,於步驟502中,於金凸塊表面鍍一鎮層,且其製作方法例如是電鍍法或無電鍍法。之後,進行步驟504,晶圓切割,以形成數個晶粒(die)。然後,進行步驟506,於晶片基材上提供一含銅的銲料,其中含銅的銲料可以是一錫銅合金,且其中的銅含量約在0.7~3.0 wt%之間。接著,於步驟508中,對準金凸塊與含銅的銲料,以接合金凸塊與含銅銲料。之後,於步驟510中,進行迴銲(reflow)。

當本實施例之結構應用於覆晶封裝技術時,由於鍍在金凸塊上的鎳層於迴銲時會與含銅銲料反應形成三元的(Cu,Ni)₆Sn₅化合物,所以可大幅降低金與錫間因迴銲所產生的介金屬化合物,如AuSn₄,故本發明可解決金凸塊結構與高錫無鉛銲料快速反應所造成的問題。

雖然本發明已以較佳實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何熟習此技藝者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可作各種之更動與潤飾,因此本發明之保護





五、發明說明 (6)

範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。



圖式簡單說明

第1圖係習知使用金凸塊於覆晶封裝時的元件剖面示意圖;

第2圖係依照本發明之一第一實施例之覆晶金凸塊的剖面示意圖;

第3圖係製造第2圖所示之覆晶金凸塊結構的步驟圖; 第4圖係依照本發明之一第二實施例之覆晶式封裝的 結構剖面示意圖;以及

第5圖係將第4圖之結構應用於覆晶式封裝的步驟圖。

圖式標示說明

100、400: 晶片

102、202、402: 金凸塊

104: 銲料

106: 脆性的金-錫化合物(cold joint)

204、404: 鎮層

206: 銅層

406: 含銅的銲料

410: 晶片基材

300、500:於晶圓上形成金凸塊

302,502:於金凸塊表面鍍一鎳層

304:於錄層表面鍍一銅層

200: 晶圓

504: 晶圓切割

506:於晶片基材上提供一含銅的銲料



圖式簡單說明

508: 對準金凸塊與含銅的銲料

510: 進行迴銲



六、申請專利範圍

1. 一種覆晶金凸塊結構,配置於一晶圓上,其結構包括:

至少一金凸塊;

- 一鎮層,鍍於該至少一金凸塊表面;以及
- 一銅層,覆蓋於該鎳層表面。
- 2. 如申請專利範圍第1項所述之覆晶金凸塊結構,其中該錄層之厚度在0.1~20微米之間。
- 3. 如申請專利範圍第1項所述之覆晶金凸塊結構,其中該銅層之厚度在0.1~10微米之間。
- 4. 如申請專利範圍第1項所述之覆晶金凸塊結構,其中該至少一金凸塊之高度在3~150微米之間。
- 5.一種覆晶式封裝的結構,配置於一晶片與一晶片基材之間,其結構包括:

至少一金凸塊,位於該晶片上;

- 一鎳層,鍍於該至少一金凸塊表面;以及
- 一含銅的銲料,位於該晶片基材上,用以接合該晶片與該晶片基材。
- 6. 如申請專利範圍第5項所述之覆晶式封裝的結構,其中該含銅的銲料包括一錫銅合金。
- 7. 如申請專利範圍第6項所述之覆晶式封裝的結構, 其中該錫銅合金之銅含量在0.7~3.0 wt%之間。
- 8. 如申請專利範圍第5項所述之覆晶式封裝的結構,其中該鎮層之厚度在0.1~20微米之間。
 - 9. 如申請專利範圍第5項所述之覆晶式封裝的結構,



六、申請專利範圍

其中該至少一金凸塊之高度在3~150微米之間。

10. 一種覆晶金凸塊結構之製造方法,配置於一晶圓上,其步驟包括:

於該晶圓上形成至少一金凸塊;

於該至少一金凸塊表面鍍一鎳層;

以及

於該鎮層表面鍍一銅層。

- 11. 如申請專利範圍第10項所述之覆晶金凸塊結構之製造方法,其中於該晶圓上形成該至少一金凸塊之步驟包括電鍍法。
- 12. 如申請專利範圍第10項所述之覆晶金凸塊結構之 製造方法,其中於該晶圓上形成該至少一金凸塊之步驟包括無電鍍法。
- 13. 如申請專利範圍第10項所述之覆晶金凸塊結構之製造方法,其中於該至少一金凸塊表面鍍該鎳層之步驟包括電鍍法。
- 14. 如申請專利範圍第10項所述之覆晶金凸塊結構之製造方法,其中於該至少一金凸塊表面鍍該錄層之步驟包括無電鍍法。
- 15. 如申請專利範圍第10項所述之覆晶金凸塊結構之製造方法,其中於該鎮層表面鍍該銅層之步驟包括電鍍法。
- 16. 如申請專利範圍第10項所述之覆晶金凸塊結構之製造方法,其中於該鎮層表面鍍該銅層之步驟包括無電鍍



六、申請專利範圍

法。

17. 一種覆晶式封裝方法,適於接合一晶片與一晶片基材,其步驟包括:

於一晶圓上形成至少一金凸塊;

於該至少一金凸塊表面鍍一線層;

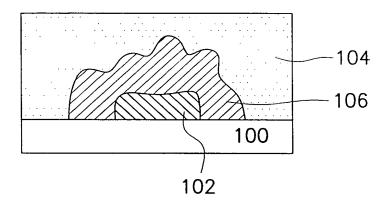
切割該晶圓;

於該晶片基材上提供一含銅的銲料;以及

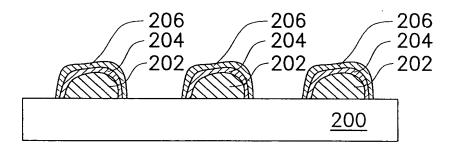
對準該至少一金凸塊與該含銅的銲料。

- 18. 如申請專利範圍第17項所述之覆晶式封裝方法,其中於該晶圓上形成該至少一金凸塊之步驟包括電鍍法。
- 19. 如申請專利範圍第17項所述之覆晶式封裝方法, 其中於該晶圓上形成該至少一金凸塊之步驟包括無電鍍法。
- 20. 如申請專利範圍第17項所述之覆晶式封裝方法,其中於該至少一金凸塊表面鍍該錄層之步驟包括電鍍法。
- 21. 如申請專利範圍第17項所述之覆晶式封裝方法, 其中於該至少一金凸塊表面鍍該鎳層之步驟包括無電鍍法。
- 22. 如申請專利範圍第17項所述之覆晶式封裝方法, 其中對準該至少一金凸塊與該含銅的銲料之後,更包括進行迴銲。

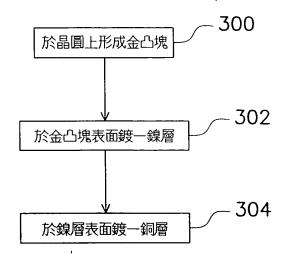




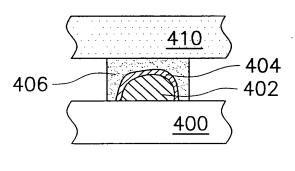
第 1 圖



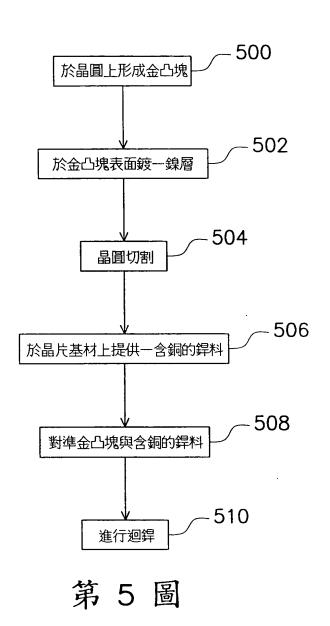
第 2 圖

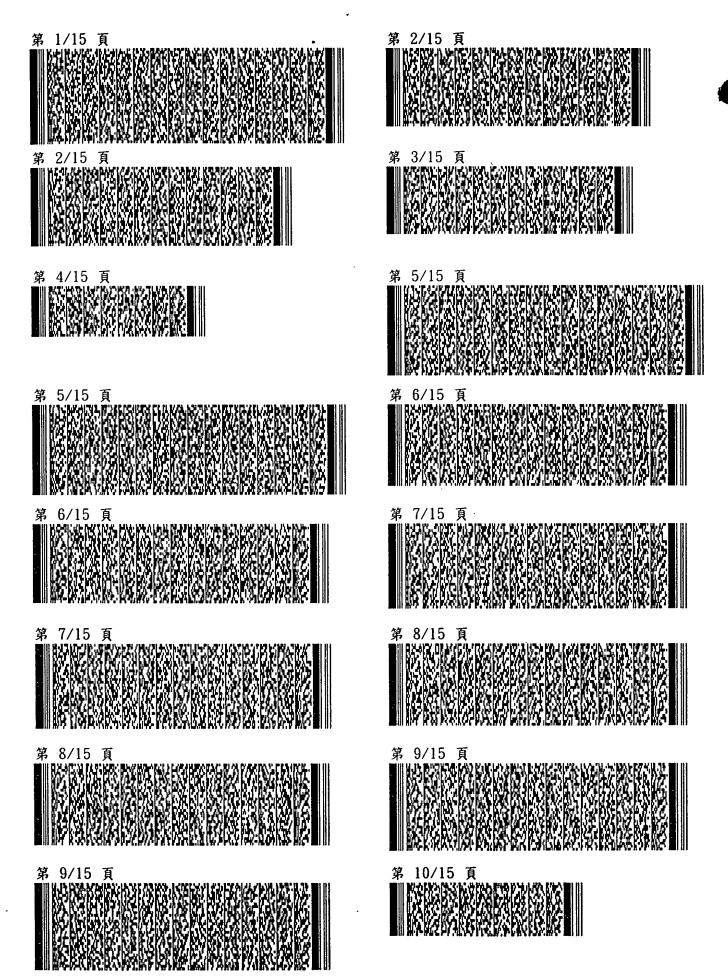


第 3 圖



第 4 圖





申請案件名稱:覆晶金凸塊結構及其製造方法









